PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-195948

(43) Date of publication of application: 11.07.2003

(51)Int.Cl.

G05D 7/06

G01F 1/00

G01F 1/42

(21)Application number: 2001-399433

(71)Applicant: OMI TADAHIRO

TOKYO ELECTRON LTD

FUJIKIN INC

(22)Date of filing:

28.12.2001

(72)Inventor:

OMI TADAHIRO

INUI HIDEJIRO

SAKAI TAIJI

UEYAMA MASAYOSHI SUGIYAMA KAZUHIKO

UNO TOMIO IKEDA SHINICHI NISHINO KOJI

NAKAMURA OSAMU

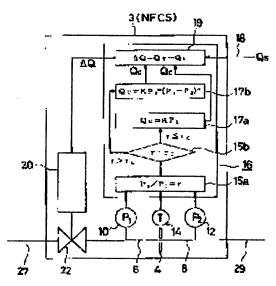
DOI RYOSUKE

MATSUMOTO SENSHI

(54) IMPROVED PRESSURE TYPE FLOW CONTROL DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To develop an improved pressure type flow control device establishing an empirical flow formula fitted with high precession to an actual flow amount of a compressible fluid in a non-critical region and performing flow control with high precision using the empirical flow formula. SOLUTION: The improved pressure type flow control device expressing the empirical flow formula for the compressible fluid in the non-critical region (non-sonic region) as Qc=KP2m(P1-P2)n (wherein K is a proportionality constant; m and n are each constants) and calculating the flow amount passing an orifice 4 using the formula Qc=KP2m(P1-P2)n accurately and speedily controls flow to be the target flow. A pressure ratio P2/P1=r obtained from an upstream pressure P1 and a downstream pressure P2 is always compared



with a critical value rc. The flow amount is calculated using Qc=KP1 for a critical condition (r≤rc), and using Qc=KP2m(P1-P2)n for a critical condition (r>rc). The flow control device then accurately and speedily controls the flow amount to be the target flow amount while corresponding to all conditions of the fluid.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2003-195948 (P2003-195948A)

(43)公開日 平成15年7月11日(2003.7.11)

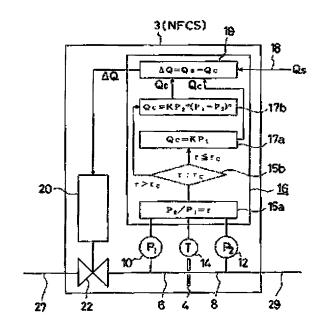
(51) Int.CL?		織別記号	FI		ラーマユード(参考)
G05D	7/06		G 0 5 D	7/06	Z 2F030
GO1F	1/00		GOlF	1/00	F 5H307
	1/42			1/42	Z
			審查商求	未選求 請求項の数 5	OL (全 8 頁)
(21)出顧番号		特嘛2001 - 399433(P2001 - 399433)	(71)出廢人	. 000205041	
				大見 忠弘	
(22)出願日		平成13年12月28日(2001.12.28)		富城県仙台市青葉区	米ケ袋2ー1ー17ー
				301	
			(71)出願入	000219967	
				東京エレクトロン株	式会社
				東京都港区赤坂五丁	目3番6号
			(71) 出願人	390033857	
				株式会社フジキン	
				大阪府大阪市西区立	売職2丁目3番2号
			(74)代理人	100082474	
				弁理士 衫本 丈夫	(外1名)
					最終質に続く

(54) 【発明の名称】 改良型圧力式流量削機装置

(57)【要約】

【課題】 非臨界領域において圧縮性流体の実際の流置 に高結度にフィットする実験流置式を確立し、この実験 流量式を用いて高精度に流量制御を行なえる改良型圧力 式流量制御装置を開発する。

【解疾手段】 非臨界領域(非音速領域)における圧縮性流体の実験流量式を $Qc = KP_1$ "($P_1 - P_2$)"によって表し、オリフィス4を通過する流体流置をこの $Qc = KP_1$ "($P_1 - P_2$)"(Kは比例定数、mとnは定数)により演算して、正確かつ高速に目的流置へと流置制御できる改良型圧力式流量制御装置を提供する。また。上流側圧力 P_1 と下流側圧力 P_2 から得られる圧力比 P_2 / $P_1 = r$ を常に臨界値 r_1 。と比較して、臨界条件($r \le r_2$)では $Qc = KP_1$ により、非臨界条件($r > r_2$)では $Qc = KP_2$ "($P_1 - P_2$)"により流量を演算して、流体の全条件に対応しながら、正確かつ高速に目的流量へと流量制御できる改良型圧力式流置制御装置を提供する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 流置制御用のオリフィスに液体を流通させるとき、オリフィスの上流側圧力P」とオリフィスの下流側圧力P」を用いて、オリフィスを通過する流体流量QcをQc=KP」"(P1-P2)"(Kは比例定数。mとnは定数)により演算することを特徴とする改良型圧力式流置制御装置。

【請求項2】 流畳制御用のオリフィスと、オリフィスの上流側配管に設けたコントロールバルブと、オリフィスとコントロールバルブの間に設けて上流側圧力P,を 15 検出する上流側圧力P,を検出する下流側圧力センサと、オリフィスの下流側配管に設けて下流側圧力P,を検出する下流側圧力センサと、上流側圧力P,と下流側圧力P,から演算流量QcをQcを保P,"(P,-P,)"(Kは比例定数,mとnは定数)により演算する流量演算手段と、下流側に流体を設定流置Qsで供給するように指令する流置設定手段と、設定流置Qsと演算流量Qcとの流置差益Qを演算する演算手段と、この流量差益Qをゼロにするようにコントロールバルブを開閉副御する駆動部から構成され、下流側配管に設定流置Qsの流体を供給制御することを 20 特徴とする改良型圧力式流量制御装置。

【請求項3】 前記オリフィスから流出する流体の速度 が音速よりも小さい状態にある非臨界条件の下で作動する 高請求項2に記載の改良型圧力式流量制御装置。

【謔水項4】 - 流置制御用のオリフィスと、オリフィス の上流側配管に設けたコントロールバルブと、オリフィ スとコントロールバルブの間に設けて上流側圧力P、を 検出する上流側圧力センサと、オリフィスの下流側配管 に設けて下流側圧力P、を検出する下流側圧力センサ と、上流側圧力P,と下流側圧力P,の圧力比によってオ リフィスから流出する流体が臨界条件(音速領域)にあ るかどうかを判断する臨界条件判断手段と、非臨界条件 では上流側圧力P、と下流側圧力P、から演算流量Qcを Q c = K P,"(P, - P,)"(Kは比例定数、mとnは 定数)により演算する非臨界流量演算手段と、臨界条件 では前記演算流量QcをQc=KP。(Kは比例定数) により演算する臨界流量演算手段と、下流側に流体を設 定流量Qsで供給するように指令する流量設定手段と、 設定流置Qsと演算流量Qcとの流量差△Qを演算する 減算手段と、この流置差△Qをゼロにするようにコント ロールバルブを開闢制御する駆動部から構成され、下流 側配管に設定流量Qsの流体を供給制御することを特徴 とする改良型圧力式流量制御装置。

【請求項5】 臨界圧力比下。(=P₂/P₃)は(2/(n+1))"(****)(但し、nはCp/Cvで定義される流体分子の比熱比)で計算され、圧力比P₂/P₃が臨界圧力比下。以下のときに臨界条件と判断し、また臨界圧力比より大きいときに非臨界条件と判断する請求項3又は4に記載の改良型圧力式流量制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は主として半導体製造設備や化学プラント等で使用される圧力式流量制御装置に関し、更に詳細には、流体速度が音速よりも小さい領域で供給される流体の流量を新規な実験式を用いて正確に定め、この実験式に基づいて流体流量を正確に供給制御する改良型圧力式流量制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造設備や化学プラントなどで 16 は、原料となる複数のガスを所定の流量で供給し、原料 ガスを反応炉の中で化学反応させて目的ガスを生成する 場合が多い。このような場合に、原斜ガスの供給流量が 正確でないと化学反応に過不足が生じ、目的ガスの中に 原斜ガスが残留する事態が生じる。

【0003】未反応状態で残留する原料ガスは不純物ガスとなり、目的ガスの純度を低下させる。特に、未反応残留ガスが爆発性のガスである場合には、後続の製造設備において爆発の危険性が付きまとい。その処理に余分な手間が掛かるという事態が生じる。

【0004】そこで、ガス流量を正確に供給制御することが必要となり。従来からマスフローコントローラをガス流量制御装置として利用する場合が多かった。ところが、マスフローコントローラには、①定答速度が比較的遅い。②低流量域における流量精度が悪い、③作動時のトラブルが多い。しかも②高コストである、等の多くの欠点があった。

【りりり5】そのため、マスフローコントローラ以外の 方式でガス流量制御の精度を高める必要性が指摘されて いた。この要請を受けて、本発明者等は、オリフィスを 通過する流体を臨界条件、即ち音速領域に強制設定して 流量制御する圧力式流置制御装置を開発し、特開平10 -55218号としてその発明を公開している。

【0006】図5は従来から用いられている流体流置の理論式の説明図である。上流側圧力P」に設定された上流側配管からオリフィスに流入した流体を、下流側配管に下流側圧力P」で供給する場合を考える。ここで、上流側圧力P」と下流側圧力P」は絶対圧力で表されている。

【0.00.7】オリフィスを通過する流体速度が音遠に達する前と、音遠に達した後では、流体の流置条件が極端に変化する事が分かっている。音速に達する前の非臨界条件(非音速領域)では、下流側流量QはQ=SC($P_1(P_1-P_2)$) $^{1/2}$ $^{1/2}$ で与えられるが、音速に達した後の臨界条件(音速領域)ではQ=SC $P_1/T^{1/2}$ が成立する。ことで、下はオリフィス通過時の流体の絶対温度、Sはオリフィス孔断面積、Cは比例係数である。

【0008】流体速度が音速に達する臨界条件は、圧力 此P₂/P₁の臨界値で、で与えられることが流体力学か 50 ち分かっている。この臨界値で、は、ガスの比熱比力を

上流側圧力P」を検出する上流側圧力センサと、オリフ ィスの下流側配管に設けて下流側圧力P」を検出する下 添測圧力センサと、上漆側圧力P、と下漆側圧力P。の圧 力比によってオリフィスから流出する流体が臨界条件。 (音速領域) にあるかどうかを判断する臨界条件判断手 段と、非臨界条件では上流側圧力P」と下流側圧力P。か ら演算流量QcをQc=KP,"(P,-P,)"(Kは比 例定数、mとmは定数)により演算する非臨界流量演算 手段と、臨界条件では前記海算衛置QcをQc=KP。 (Kは比例定数)により演算する臨界流量演算手段と、 下流側に流体を設定流置Qsで供給するように指令する 流量設定手段と、設定流量Qsと演算流量Qcとの流量。 差△Qを演算する減算手段と、この流量差△Qをゼロに するようにコントロールバルブを関閉制御する駆動部か ら構成され、下流側配管に設定流置Q s の流体を供給制 御することを特徴とする改良型圧力式流量制御装置であ る。

【0023】請求項5の発明は、臨界圧力比で。(=P。 /Pi)は(2/(n+1))"/("-1)(但し、nはCp 力比P。/P,が臨界圧力比ェ。以下のときに臨界条件と 判断し、また臨界圧力比より大きいときに非臨界条件と 判断する請求項3又は4に記載の改良型圧力式流量制御 接置である。

[0.024]

【発明の真施の形態】図1は本発明に係る非臨界条件に おける流量実験式と流量測定値の比較図である。本発明 者等は非臨界条件に使用される従来の理論流置式を検討 した。ベルヌーイの定理から導出される従来流量式は、 Q c = K { P₂ { P₁ - P₂} } バである。書き換える と、Qc=KP2*** (P1-P2)***となる。

【0025】この従来流量式は非圧縮性流体に対しては 正確な式であり、例えば非圧縮性液体などの流体に対し ては十分に精度のある流量式である。この流量式をガス などの圧縮性流体に適合させるためには、この構造形式 をできるだけ変えない複数パラメータを有した実験流量 式を確立する必要がある。

【0026】そこで、本発明者等は、実験適置式とし て、Qc=KP₂" (P,-P₂) "を提案し、フィッティ ング用に血とれの2パラメータを導入することにした。 ここで、比例定数ドはド=SC/T*パで与えられ、ガ ス流の物質条件と絶対温度Tから計算される。

【0027】図1において、構輸は下流側圧力P。を表 し、単位は k P a A (キロバスカル絶対圧) である。ま た、縦軸は流量Qを表し、単位はSCCMで、標準状態 におけるcc/mn単位の流置を表す。P,=4.8[kP 8 A]の縦破線は臨界値での位置を示し、左側の(A) 鎖域は臨界条件の領域、右側の(B)領域は非臨界条件 の領域を示している。

たものであり、との実測値に合うように前記実験流量式 $Q c = KP_2$ " $(P_1 - P_2)$ "を演算によりフィットさ せ、バラメータm、nを決定する。その結果、m=0. 47152及びn=0.59492が得られた。

【0029】実験流置式によって計算される流量は黒四 角でブロットされている。この実験流量式は非臨界条件 (B) の全領域で実測値に高精度にフィットしており、 また臨界条件(A)の領域でも縦破線に近い領域では実 測値にフィットしている。 mとnの二つの自由バラメー 10 夕によってフィットさせているため、臨界条件領域の一 部においてもフィットする領域が現れたのである。

【0030】本発明者等の研究によれば、二つのバラメ ータm、nの値は、制御される流量範囲に依存すること が分かっている。前記したm=0.47152及びn= 0. 59492の値は、流量が0~10sccmの領域 において成立する値であるが、流量簡囲が()~1()()s ccmや0~1000sccmになると、mとnの値は これらの値からずれてくることが分かっている。

【0031】呂流量範圍に対してフィットされたmとn /C v で定義される権体分子の比熱比)で計算され、圧 20 の値をバラッキの観点からまとめると。()。4() < m < 0.50及び0.50<n<0.65の範圍が得られる ことが分かった。従って、実際の漆量訓御においては、 制御される流量範囲に応じて、これらの範囲から選択さ れた最適のパラメータm、nの値が用いられる。

> 【0032】前途したm=0.47152及びn=0. 59492の値は、これらの範囲から選択されたm、n の一例に過ぎない。しかしながら、ベルヌーイの定理か ら得られるm=0.5及びn=0.5がこれらの範圍に 含まれていないことは、特筆すべきことである。このこ 30 とは実際の液体が非圧縮性流体という理想流体とは大き く異なることを意味している。本発明はこの現実流体に 対して具体的に成立する流量実験式を発見してなされた ものである。

> 【0033】以上から、非臨界条件における流量制御で は、実験流置式としてQc=KP," (P,-P,) " $\{0, 40 \le m \le 0, 50, 0, 50 \le n \le 0, 6\}$ 5)を利用すれば、高精度の流量制御を実現できる。こ ればベルヌーイの定理から得られる従来のQc=KP。 ^{3/4}〈 P₁ - P₂〉^{3/4}よりもはるかに実測値を再現できる 40 ものである。同時に、臨界条件における理論流量式とし てQc=KPaを併用することにより、非臨界条件及び 臨界条件の全領域にわたって高精度の流量制御を達成す る事が可能となる。

【①①34】図2は本発明の実験流量式を用いた改良型 圧力式流量制御装置の第1実施形態の使用構成例であ る。この改良型圧力式流量制御装置2は、供給される流 体が非臨界条件にある場合。即ちオリフィス4から流出 する流体の流体速度が音速より小さい場合を前提に構成 されている。

【0028】図中、黒菱形は流置の実測値をフロットし 50 【0035】との改良型圧力式流置制御装置2には、オ

 r_z =0.53、非直線型3原子分子ガスでは r_z =0.54であり、 r_z =約0.5と表記される。

【 0 0 5 2 】 r > r。のときは非臨界条件であり、非臨 界流量演算手段 1 7 b により、演算流量Q c はQ c = K P₂" (P, -P₂) "から計算される。 r ≤ r₂のときは臨 界条件であり、臨界流置演算手段 1 7 a により、演算流 置Q c はQ c = K P, から計算される。このように現在 の流体が臨界条件又は非臨界条件のいずれかにあるかを 意時チェックしながら、実際の流置を適切な流量式で推 定するのである。

【 0 0 5 3 】最終的に、設定適置 Q s と 海導適量 Q c と の流量差 Δ Q を 減算手段 1 9 で計算して、適置差 Δ Q が ゼロになるように バルブ駆動部 2 0 を動作させてコント ロールバルブ 2 2 を 関閉制御する。

【①①54】図4は制御用の流量式が異なる場合の流量の比較図である。黒菱形は臨界条件の流量式Q=KP、を全領域(臨界条件と非臨界条件)に対して使用した場合を示し、従来のFCS(Flow Control system)に相当する。他方、黒三角は図3に示すNFCS(新型FCS)に相当する。

【0055】最大流置を80[SCCM]とし、設定流置 Qsを100%としたときに80[SCCM]の流量が流 れるように設定する。従がって、流量が大きいほど臨界 条件(音速領域)が満足され、流置が小さくなるほど非 臨海条件(非音速領域)に移行すると考えられる。

【0056】従来のFCS(黒菱形)ではQ=KP,の 流量式だけで全領域を制御するから、設定流量が大きい 場合には臨界条件が満足され、正しい流置を示してい る。ところが、設定流量が小さくなると、非臨界条件に 移行するから、臨界条件の流量式では正確な流量を反映 30 せず、設定流量が10%もあるのに流量=0と間違った 結果を出してしまう。従がって、小流量域ではFCSを 結正する機構が必要であった。

【0.057】ととろが、NFCSの場合には、臨界条件では臨界条件の流量式Qc = KP、を用い、非臨界条件では非臨界条件の実験流量式Qc = KP、" $\{P_1 - P_2\}$ "を用いるから、設定流量に比例した正確な流量Qを算出し、流量Qの設定%に対する直線性が図4の黒三角に示すように保証されている。

【 0 0 5 8 】本発明は上記実施形態に限定されるもので 46 はなく、本発明の技術的思想を透脱しない範囲における 種々の変形例・設計変更などをその技術的範囲内に包含 することは云うまでもない。

[0059]

【発明の効果】請求項1の発明によれば、オリフィスを通過する流体流量Qcを実際の流量を正確に再現する実験流量式Qc=KP,"(P₁-P₂)"で消算するから、流量制御を高請度に行なえる改良型圧力式流量制御装置

を実現できる。

【0060】請求項2の発明によれば、設定適量Qsに対し、演算適量QcをQc=KP,"(P,-P,)"で演算し、両者の流量差△Q(=Qs-Qc又はQc-Qs)をゼロにするようにコントロールバルブを開閉制御するから、供給流量を正確かつ高速に設定適置へと制御できる改良型圧力式適量制御装置を実現できる。

10

【0061】語求項3の発明によれば、オリフィスから 流出する流体が非臨罪条件にあるときに請求項2の改良 型圧力式流置制御装置を動作させるから、高精度の改良 型圧力式流置制御装置を提供できる。

【0062】語求項4の発明によれば、オリフィスから 流出する流体が臨界条件にあるときには臨界条件の流置 式Q=KP1を用い、非臨界条件にあるときには非臨界 条件の実験流量式Qc=KP₂"(P_1-P_2)"を用いて 流量制御するから、流体が臨界条件から非臨界条件の間 を変化しても、この変化に高速に追従しながら流体の流 置制御を高精度に行なうことができる。

【0063】語求項5の発明によれば、オリフィスの上 20 添側圧力P、と下添側圧力P、を検出するだけで、流体が 庭界条件にあるか非庭界条件にあるかを正確に判断で き、あちゆる流体制御に対応することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る非臨界条件における流置実験式と 流量測定値の比較図である。

【図2】本発明に係る実験流置式を用いた改良型圧力式 漆量制御装置の第1字施形態の使用構成図である。

【図3】本発明に係る実験流量式を用いた改良型圧力式 流量制御装置の第2実施形態の使用構成図である。

【図4】制御用の流置式が異なる場合の流置の比較図である。

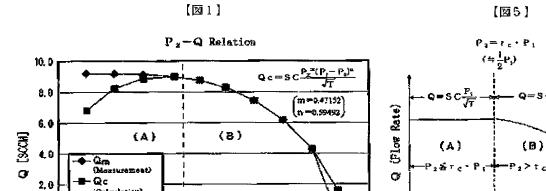
【図5】従来から用いられている流体流量の理論式の説明図である。

【符号の説明】

2は改良型圧力式流置制御装置、3は改良型圧力式流置制御装置(NFCS)、4はオリフィス、4 aはオリフィス孔、6は上流側配管、8は下流側配管、10は上流側圧力センサ、14は温度センサ、15 aは圧力比消算手段、15 bは臨界条件判断手段、16は制御回路、17は流置消算手段、17 aは臨界流置消算手段、17 bは非臨界流量消算手段、18は流量設定手段、19は減算手段、20はバルブ駆動部、22はコントロールバルブ、24はガスタンク、26はレギュレータ、27は供給側配管、28はバルブ、29は制御側配管、30はバルブ、32はチャンバー、34はドライボンブ、Piは上流側圧力、Piは下流側圧力、rは圧力比(Pi/Pi)、riは臨界値、Qcは消算流量、Qsは設定流置、4Qは流置差である。

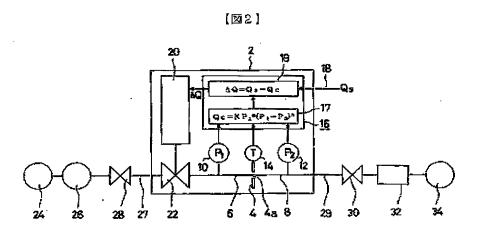
12.0

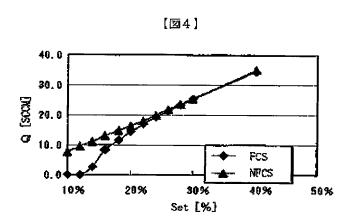
P₂ (Downstream Pressure)



8.0

10. 0





4.0

2, 8

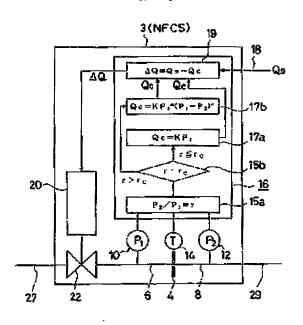
6, C

P₂ [kPaA]

0, 0

0, 8

[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 大見 忠弘 宮城県他台市青葉区米ケ袋2丁目] 番<u>1</u>7-301号

(72)発明者 乾 秀二郎兵庫県西宮市五月ヶ丘8-27

(72)発明者 酒井 泰治 大阪府吹田市垂水町 1 丁目26香25号

(72)発明者 植山 将宜 大阪府箕面市新稲3-8-8

(72)発明者 杉山 一彦 山梨県韮崎市藤弁町北下条2381香地の1 東京エレクトロン株式会社内

(72)発明者 宇野 富雄 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 (72)発明者 池田 信一 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 西野 功二 大阪府大阪市西区立完堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 中村 峰 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 土肥 亮介 大阪府大阪市西区立完場2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 松本 鷹諮 大阪府大阪市西区立完堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

F ターム(参考) 2F030 CA04 CC11 CE04 CF05 CF08 5H307 AA02 AA20 BB01 DD01 DD07 DD08 DD12 DD17 EE02 FF03 FF12 FF13 FF15 JJ01 JJ03